

Machine De Revêtement Par Évaporation Améliorée Par Plasma Pecvd

Numéro d'article: KT-PED



Introduction

Améliorez votre processus de revêtement avec l'équipement de revêtement PECVD. Idéal pour les LED, les semi-conducteurs de puissance, les MEMS, etc. Dépose des films solides de haute qualité à basse température.

[En savoir plus](#)

Porte-échantillon	Taille	1-6 pouces
	Vitesse de rotation	0-20rpm réglable
	Température de chauffage	≤800°C
	Précision du contrôle	±0.5°C Contrôleur PID SHIMADEN
Purge de gaz	Débitmètre	CONTRÔLEUR DE DÉBITMÈTRE MASSIQUE (MFC)
	Canaux	4 canaux
	Méthode de refroidissement	Refroidissement par circulation d'eau
Chambre à vide	Taille de la chambre	Φ500mm X 550mm
	Port d'observation	Port d'observation avec déflecteur
	Matériau de la chambre	Acier inoxydable 316
	Type de porte	Porte à ouverture frontale
	Matériau du capuchon	Acier inoxydable 304
	Orifice de la pompe à vide	Bride CF200
	Orifice d'entrée de gaz	φ6 Connecteur VCR
Puissance du plasma	Alimentation de la source	Alimentation DC ou RF
	Mode de couplage	Couplage inductif ou capacitif à plaque
	Puissance de sortie	500W-1000W
	Puissance de polarisation	500v
Pompe à vide	Pré-pompe	Pompe à vide à palettes 15L/S
	Orifice de la turbopompe	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Orifice de décharge	KF25
	Vitesse de la pompe	Pompe à palettes:15L/s[]Turbo pompe:1200l/s[]1600l/s
	Degré de vide	≤5×10-5Pa
	Capteur de vide	Jauge à vide à ionisation/résistance/jauge à film
Systeme d'alimentation	Alimentation électrique	AC 220V /380 50Hz

Puissance nominale	5kW
Dimensions de l'appareil	900mm X 820mm X 870mm
Poids	200 kg